


 行业动态
Industry News


日本堀场制作所开发出光掩模异物检查装置 信噪比提高到5倍

2007-11-30 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

日本堀场制作所开发出了光掩膜（Reticle/Mask）及的异物检查装置“PR-PD2HR”，该产品的信噪比（S/N）提高到以往机型的5倍，从而提高了异物的检查能力。可在进行了图案加工后的光掩模上，检测到直径0.35 μ m的异物。此外，以前机型无法检查位于表模（Pellicle）的边框4mm以内的区域，此次通过提高S/N的比数，检查范围扩大到了距边框1mm处。

此次装置的照明用光束的光点直径比以前机型有所缩小，提高了来自测量面的散射光S/N比，提高了异物检测能力。分别从图案面（表面）、玻璃面（背面）、表膜面三方面检测150mm见方的光掩模的100mm \times 100mm区域时，处理能力（Throughput）可达3片/小时。

测量时使用的照明光源，是发光波长为488nm、输出功率为10mW的Ar气体激光器。该照明光源可支持含局部洁净技术“SMIF（机械标准介面，Standard Mechanical Interface）”系统在内的各厂商的光掩模盒（Stepper Case）。

该装置的尺寸为1710mm \times 1280mm \times 1540mm。该公司将从2007年12月开始接受该装置的订单。

交货期为接到订单起的5个月。价格为9800万日元起。

该公司将在2007年12月5~7日日本千叶县幕张Messe会展中心举办的“SEMICON JAPAN 2007”展会上展出该产品。

（来源：日经BP社）

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意